

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION  
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)(19) Organisation Mondiale de la Propriété  
Intellectuelle  
Bureau international(43) Date de la publication internationale  
3 mars 2005 (03.03.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale  
WO 2005/019160 A1(51) Classification internationale des brevets<sup>7</sup> :  
C07C 253/34, 253/10, 255/04(21) Numéro de la demande internationale :  
PCT/FR2004/001972

(22) Date de dépôt international : 23 juillet 2004 (23.07.2004)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :  
03/09152 25 juillet 2003 (25.07.2003) FR(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) :  
RHODIA POLYAMIDE INTERMEDIATES [FR/FR];  
Avenue Ramboz BP 33, F-69192 SAINT-FONS (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : GERBER,  
Jérôme [FR/FR]; Appt 10, 23, rue président KRUGER,  
F-69008 LYON (FR). LECONTE, Philippe [FR/FR]; 43,  
rue Sainte Beuve, F-69330 MEYZIEU (FR). AMOROS,  
Daniel [FR/FR]; 12 impasse Mercy, F-69200 Venissieux  
(FR).(74) Mandataire : ESSON, Jean-Pierre; RHODIA SER-  
VICES, Direction de la Propriété Industrielle, Centre  
de Recherches de Lyon B.P. 62, F-69192 SAINT-FONS  
CEDEX (FR).(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de  
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,  
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,  
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,  
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,  
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG,  
MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH,  
PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN,  
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de  
protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,  
GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,  
ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),  
européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,  
FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI,  
SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,  
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

## Publiée :

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abrévia-  
tions, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et  
abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de  
la Gazette du PCT.

(54) Title: METHOD OF PRODUCING AND SEPARATING DINITRILE COMPOUNDS

(54) Titre : PROCEDE DE FABRICATION ET DE SEPARATION DE COMPOSES DINITRILES

(57) Abstract: The invention relates to a method of producing and separating dinitrile compounds. More specifically, the invention relates to a method of producing and separating dinitrile compounds from a medium resulting from the hydrocyanation of unsaturated mononitriles. The inventive method consists in: (i) supplying the dinitrile-containing medium to a distillation column; and (ii) recovering the purified dinitriles as the intermediate fraction, the heavy products being eliminated as the bottom fraction and the light products, including the unsaturated mononitriles, being recovered as the top fraction.

(57) Abrégé : La présente invention concerne un procédé de fabrication et de séparation de composés dinitriles. Elle se rapporte, plus particulièrement, à un procédé de fabrication et de séparation de composés dinitriles à partir d'un milieu provenant de l'hydrocyanation de mononitriles insaturés. L'invention consiste à alimenter le milieu contenant les dinitriles dans une colonne de distillation et à récupérer comme fraction intermédiaire les dinitriles purifiés, les produits lourds étant éliminés comme fraction de queue de colonne et les produits légers dont les mononitriles insaturés étant récupérés comme fraction de tête